

111...SUBSTRATE STOCK ROOM	30...SCRIBE ROOM
112...PISTON-TRAPING ROOM	212...WAXING GLASS TYPING ROOM
113...VAPOR DEPOSITION ROOM	213...GLAZING GLASS STOCK ROOM
114...VAPOR DEPOSITION ROOM	214...UV IRRADIATION ROOM
115...VAPOR DEPOSITION ROOM	215...DISCHARGE ROOM
216...VAPOR DEPOSITION ROOM	316...INSULATION ROOM
6...CONVEYING ROOM	
13...COMMUNICATING PASSAGE	

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

真空または不活性ガス雰囲気中で、陽極層、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層、陰極層の各層を脆性基板上に、各有機 E L ディスプレイとなる部分毎に成膜する成膜手段と、真空または不活性ガス雰囲気中で、前記脆性基板上の各層を前記部分毎に気密状態に封止する封止部材を設ける封止手段とを具備し、
前記脆性基板の各有機 E L ディスプレイとなる部分毎に用いられる所定部分領域に対してスクライブラインが封止前に形成されていると共に、
前記封止部材は、前記脆性基板上に形成された各有機 E L ディスプレイとなる部分毎に積層された各層をそれぞれ収納する凹部が形成されていることを特徴とする有機 E L ディスプレイ製造装置。 10

【請求項 2】

前記成膜手段により各層が成膜される脆性基板上に、真空または不活性ガス雰囲気中で、前記脆性基板の各有機 E L ディスプレイとなる部分毎に用いられる所定部分領域に対してスクライブラインを形成するスクライプ手段を具備することを特徴とする請求の範囲第 1 項に記載の有機 E L ディスプレイ製造装置。

【請求項 3】

前記封止部材は、前記スクライプ手段により形成されるスクライブラインの位置に対応して予めスクライブラインが形成されている 1 枚の平板状に構成されていることを特徴とする請求の範囲第 2 項に記載の有機 E L ディスプレイ製造装置。 20

【請求項 4】

真空または不活性ガス雰囲気中で、陽極層、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層、陰極層の各層を脆性基板上に、各有機 E L ディスプレイとなる部分毎に成膜する成膜工程と、真空または不活性ガス雰囲気中で、前記脆性基板上の各層を前記部分毎に気密状態に封止する封止部材を取り付ける封止部材取付工程とを具備し、
前記脆性基板の各有機 E L ディスプレイとなる部分毎に用いられる所定部分領域に対してスクライブラインが封止部材取付工程前に形成されており、
前記封止部材は、前記脆性基板上に形成された各有機 E L ディスプレイとなる部分毎に積層された各層をそれぞれ収納する凹部が形成されていることを特徴とする有機 E L ディスプレイの製造方法。 30

【請求項 5】

前記成膜工程において各層が成膜される脆性基板上に、真空または不活性ガス雰囲気中で、前記脆性基板の各有機 E L ディスプレイとなる部分毎に用いられる所定部分領域に対してスクライブラインを形成するスクライプ工程を具備することを特徴とする請求の範囲第 4 項に記載の有機 E L ディスプレイの製造方法。

【請求項 6】

前記封止部材は、前記スクライプ工程において形成されるスクライブラインの位置に対応して予めスクライブラインが形成されている 1 枚の平板状に構成されていることを特徴とする請求の範囲第 4 項または第 5 項に記載の有機 E L ディスプレイの製造方法。

【請求項 7】

前記脆性基板と前記封止部材とを同時に一度の分断操作により分断する工程をさらに具備することを特徴とする請求の範囲第 4 項～第 6 項のいずれかに記載の有機 E L ディスプレイの製造方法。 40

【発明の詳細な説明】

技術分野

本発明は、ガラス基板上に形成された有機発光層を封止部材によって封止した構造を有する有機 E L ディスプレイを製造する有機 E L ディスプレイ製造装置及び有機 E L ディスプレイの製造方法に関する。

背景技術

有機 E L (E l e c t r o L u m i n e s c e n c e) ディスプレイは、現在フラット 50

パネルディスプレイの主流となっている液晶ディスプレイに比較して様々な優位性を有しており、この液晶ディスプレイに置き換えられることが将来的に見込まれる次世代のフラットパネルディスプレイとして注目を集めている。

図6は、一般的な有機ELディスプレイの概略構成を示す斜視図である。

この有機ELディスプレイ1は、透明なガラス基板2を有しており、このガラス基板2上に複数の陽極層3がITO等の透明な導電性材料により、それぞれ所定の間隔を空けたストライプ状に設けられている。各陽極層3の上には、直流電圧を印加することにより正孔を供給する正孔輸送層4、微量の有機色素をドーパントとして含む有機発光層5、直流電圧を印加することにより電子を供給する電子輸送層6が、順次、ガラス基板2上にこの順に積層されている。最上層となる電子輸送層6上には、導電性材料からなる複数の陰極層7が、それぞれ所定の間隔を空けて各陽極層3が延びる方向とは直交する方向に延びるストライプ状に設けられている。

ガラス基板2上の各陽極層3は、それぞれ直流電源8の陽極に接続され、また、最上層の各陰極層7は、それぞれ直流電源8の陰極に接続されている。

上記構成の有機ELディスプレイの各陽極層3と陰極層7との間に直流電源8により直流電圧を印加すると、直流電圧が印加された陽極層3上に積層された正孔輸送層4から正孔が有機発光層5中に注入されるとともに、直流電圧が印加された陰極層7の下層の電子輸送層6から電子が有機発光層5中に注入される。正孔輸送層4からの正孔及び電子輸送層6からの電子がそれぞれ注入された有機発光層5中では、各正孔と電子とが再結合して、この再結合により発生したエネルギーが有機発光層5に含まれる有機色素に吸収されて発光する。有機発光層5にて発生した光は、正孔輸送層4、陽極層3、ガラス基板2を順次透過して、ガラス基板2の裏面(図6において下側)から出射される。

この有機ELディスプレイ1では、ガラス基板2上に形成された複数の陽極層3と最上層に設けられた複数の陰極層7とが、それぞれ直交して交差しており、各交差部分ごとに、直流電圧の印加をTFE等によって調整することにより、各交差部分を表示の1単位とする画像光をガラス基板2の外側に形成することができる。

有機ELディスプレイ1は、正孔輸送層4上に積層される有機発光層5が水分に極めて弱く、大気に触れただけで、ダークスポットと呼ばれる黒点となって画像光の非表示欠陥となって表れるため、真空または不活性ガス条件とされたチャンバー内で各層の成膜工程を行った後、そのまま、大気に触れない状態を維持して、図7に示すように、封止キャップ9を設けて、有機発光層5等を大気と遮断した状態とする。これにより、水分によるダークスポットの発生が防止される。

図8は、有機ELディスプレイを製造するための有機EL製造装置の概略構成を示す構成図である。

この有機EL製造装置10は、ガラス基板2上に有機発光層5等の成膜工程を行う成膜室11と、成膜後のガラス基板2上に封止キャップ9を設ける封止室12とを有し、成膜室11及び封止室12とは、連絡通路13によって連結されている。

成膜室11は、搬送ロボット110aを備えた搬送室110を中央部に有し、この搬送室110から放射状に、ガラス基板2をストックする基板ストック室111、成膜前のガラス基板2に対して洗浄等の前処理を行う前処理室112、陽極層3、正孔輸送層4、有機発光層5、電子輸送層6、陰極層7の各層をガラス基板2に蒸着する複数の蒸着室113～116が、それぞれ、所定の間隔を空けて配置されている。中央に配置された搬送室110と、基板ストック室111及び前処理室112及び各蒸着室113～116との間には、それぞれ、ガスの流通状態を開閉できるゲートバルブ111a～116aが設けられている。また、基板ストック室111と外部側には、ガラス基板2を搬入する際に内部を大気圧の状態にするためのゲートバルブ111b、搬送室110と連絡通路13との間には、成膜後のガラス基板2を封止室12側に搬送する際に各空間のガスを連通状態とするゲートバルブ13aが、それぞれ設けられている。

封止室12は、搬送ロボット120aを備えた搬送室120を中央部に有し、この搬送室120から放射状に、ガラス基板2上に形成された有機発光層5等の各層の状態を検査す

る検査室121、ガラス基板2上に形成された各層上に封止キャップ9を設ける封止キャップ固定室122、封止キャップ9をストックするキャップストック室123、封止キャップ9が設けられたガラス基板2を外部に搬出する排出室124、予備用に備えられている予備室125及び126が、それぞれ、所定の間隔を空けて配置されている。中央に配置された搬送室120と、検査室121、封止キャップ固定室122、キャップストック室123、予備室125及び126、排出室124との間には、それぞれ、ガスの流通状態を開閉できるゲートバルブ121a～126aが設けられている。また、キャップストック室123には、封止キャップ9をキャップストック室123内にストックするために搬入する際に内部を大気圧に等しくするためのゲートバルブ123bが設けられており、また、排出室124には、封止キャップ9が取り付けられたガラス基板2を外部に搬出する際に内部を大気圧に等しくするためのゲートバルブ124bが設けられている。また、成膜室11の各室110～116、連絡通路13、封止室12の各室120～126には、図示しないガス供給ライン及びガス排出ラインがそれぞれ設けられており、各室の内部をそれぞれ所望のガスが充填された所望の圧力状態に調整できるようになっている。

この有機EL製造装置10によって有機ELディスプレイを製造するには、基板ストック室111にストックされたガラス基板2を搬送室110の搬送ロボット110aにより前処理室112に搬送して、所定の前処理を行った後、各蒸着室113～116に搬送して、所定のガスが所定圧に充填された条件下において、陽極層3、正孔輸送層4、有機発光層5、電子輸送層6、陰極層7の各層を順次積層する。この間、搬送室110と各室111～116との間に設けられたそれぞれのゲートバルブ111a～116aを開閉し、図示しないガス供給ライン及びガス排出ラインから所定のガスの導出入が行われて各室のガス圧が調整されるが、ガラス基板2が大気に接触しないようになっている。

成膜室11にて各層が積層されたガラス基板2は、連絡通路13を通して、気密の状態を維持したまま、封止室12に搬送され、この封止室12の搬送室120に備えられた搬送ロボット120aにより、検査室121に搬送されて所定の検査が行われた後、封止キャップ固定室122に搬送されて、キャップストック室123にストックされた封止キャップ9がガラス基板2上の所定位置に設けられる。

そして、封止キャップ9が設けられて有機発光層5等の各層が封止状態になったガラス基板2は、排出室124から外部に搬出され、有機ELディスプレイが製造される。

有機ELディスプレイに使用される有機発光層5は、微量の水分が含まれていれば、ダークスポット発生の原因となるために、水分を含まないチャンバー中で成膜工程を行った後、大気中に取り出すことなく、そのまま水分を含まない状態とされて、各層上を覆うように封止キャップ9が設けられる。封止キャップ9は、ガラス基板2との接触面にUV硬化性の接着剤が塗布されて、ガラス基板2側からUV光が照射されてガラス基板2上に固定される。

有機ELディスプレイは、上記のように、水分が除去された状態にて作製される必要があり、その作製の量産性を向上させるためには、大面積のガラス基板を用いて、同時に複数の有機ELディスプレイのための成膜工程を行い、各有機ELディスプレイ毎に封止キャップを設け、その後、複数の有機ELディスプレイが形成された大面積のガラス基板を、各有機ELディスプレイが形成された部分毎に、スクライブラインを形成し、このスクライブラインに曲げモーメントを作用させて各有機ELディスプレイに分断することにより、同時に複数の有機ELディスプレイを製造することが必要である。

しかし、この方法では、ガラス基板2において、封止キャップ9が設けられた側と同じ面側にスクライブラインを形成する場合、封止キャップ9があるために、封止キャップ9に近接した位置にスクライブラインを形成することが困難であり、封止キャップ9から所定距離離れた位置にスクライブラインを形成しなければならないという問題がある。

また、ガラス基板2において、封止キャップ9が設けられた側と反対側にスクライブラインを設ける場合には、ガラス基板2から所定高さに突出する封止キャップ9のために、ガラス基板2を安定的に支持することが困難であり、安定してスクライブラインを形成する

ことが容易ではない。また、スクライブラインが形成される反対側の封止キャップ 9 のガラス基板 2 との接触面には、硬化した接着剤が形成されており、この接着剤の影響によって、スクライブラインから分断（ブレイク）される方向が必ずしも所望の方向に進行せず、所望の分断面が得られないという問題もある。

さらに、この方法では、ガラス基板 2 上のそれぞれの有機 EL ディスプレイの領域となる部分ごとに、封止キャップを精密に設けなければならないため、封止キャップの貼付位置のアライメントに対応することが容易ではないという問題もある。

本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、有機発光層等の各層が複数設けられたガラス基板において、ガラス基板上に形成された各層の位置のアライメントに対応した封止部材の取付を容易に行い得る有機 EL ディスプレイ製造装置及び有機 EL ディスプレイ製造方法を提供することを目的とする。 10

発明の開示

上記課題を解決するため、本発明の有機 EL ディスプレイ製造装置は、真空または不活性ガス雰囲気中で、陽極層、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層、陰極層の各層を脆性基板上に、各有機 EL ディスプレイとなる部分毎に成膜する成膜手段と、真空または不活性ガス雰囲気中で、前記脆性基板上の各層を前記部分毎に気密状態に封止する封止部材を設ける封止手段とを具備し、前記脆性基板の各有機 EL ディスプレイとなる部分毎に用いられる所定部分領域に対してスクライブラインが封止前に形成されていると共に、前記封止部材は、前記脆性基板上に形成された各有機 EL ディスプレイとなる部分毎に積層された各層をそれぞれ収納する凹部が形成されていることを特徴とするものである。 20

上記本発明の有機 EL ディスプレイ製造装置において、前記成膜手段により各層が成膜される脆性基板上に、真空または不活性ガス雰囲気中で、前記脆性基板の各有機 EL ディスプレイとなる部分毎に用いられる所定部分領域に対してスクライブラインを形成するスクライブ手段を具備することが好ましい。

上記本発明の有機 EL ディスプレイ製造装置において、前記封止部材は、前記スクライブ手段により形成されるスクライブラインの位置に対応して予めスクライブラインが形成されている 1 枚の平板状に構成されていることが好ましい。

また、本発明の有機 EL ディスプレイの製造方法は、真空または不活性ガス雰囲気中で、陽極層、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層、陰極層の各層を脆性基板上に、各有機 EL ディスプレイとなる部分毎に成膜する成膜工程と、真空または不活性ガス雰囲気中で、前記脆性基板上の各層を前記部分毎に気密状態に封止する封止部材を取り付ける封止部材取付工程とを具備し、前記脆性基板の各有機 EL ディスプレイとなる部分毎に用いられる所定部分領域に対してスクライブラインが封止部材取付工程前に形成されており、前記封止部材は、前記脆性基板上に形成された各有機 EL ディスプレイとなる部分毎に積層された各層をそれぞれ収納する凹部が形成されていることを特徴とするものである。 30

上記本発明の有機 EL ディスプレイの製造方法において、前記成膜工程において各層が成膜される脆性基板上に、真空または不活性ガス雰囲気中で、前記脆性基板の各有機 EL ディスプレイとなる部分毎に用いられる所定部分領域に対してスクライブラインを形成するスクライブ工程を具備することが好ましい。

上記本発明の有機 EL ディスプレイの製造方法において、前記封止部材は、前記スクライブ工程において形成されるスクライブラインの位置に対応して予めスクライブラインが形成されている 1 枚の平板状に構成されていることが好ましい。 40

上記本発明の有機 EL ディスプレイの製造方法において、前記脆性基板と前記封止部材とを同時に一度の分断操作により分断する工程をさらに具備することが好ましい。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の有機 EL ディスプレイ製造装置について、図面に基づいて説明する。

図 1 は、本発明の有機 EL ディスプレイ製造装置 100 の概略構成を示す構成図である。

なお、製造される有機 EL ディスプレイ装置は、図 6 に示す構造と同様の構造になっている。

この有機 EL ディスプレイ製造装置 100 は、ガラス基板（脆性基板）2 上に有機発光層 50

5等の各層の成膜工程を行う成膜室11と、成膜後のガラス基板2上に封止ガラスを設ける封止室20とを有し、この成膜室11と封止室20とは、連絡通路13によって連結されている。

成膜室11は、搬送ロボット110aを備えた搬送室110を中央部に有し、この搬送室110から放射状に、ガラス基板2をストックする基板ストック室111、成膜前のガラス基板2に対して洗浄等の前処理を行う前処理室112、陽極層3、正孔輸送層4、有機発光層5、電子輸送層6、陰極層7の各層をガラス基板2に蒸着する複数の蒸着室113～116が、それぞれ、所定の間隔を空けて配置されている。中央部に配置された搬送室110と、基板ストック室111及び前処理室112及び各蒸着室113～116との間には、それぞれ、ガスの流通状態を開閉できるゲートバルブ111a～116aが設けられている。また、基板ストック室111及び前処理室112及び各蒸着室113～116には、それぞれ図示しないガス供給ライン及びガス排出ラインが設けられており、各室の内部を所望のガスが充填された所望の圧力状態に調整できるようになっている。

封止室20は、搬送ロボット210aを備えた搬送室210を中央部に有し、この搬送室210から放射状に、ガラス基板2上に形成された有機発光層5等の各層の状態を検査する検査室216と、ガラス基板2を各有機ELディスプレイ毎に分断するためのスクライブラインをガラス基板2の表面上に形成するスクライブ室30と、ガラス基板2上に形成された有機発光層5等の各層を覆う封止ガラス300をストックする封止ガラスストック室213と、ガラス基板2上に封止ガラス300を載置する封止ガラス固定室212と、封止ガラス300のガラス基板2との当接面に貼付されたUV硬化性接着剤を硬化させるためにUV光を照射するUV照射室214と、封止ガラス300が貼り付けられたガラス基板2を外部に排出する排出室215とが、それぞれ、所定の間隔を空けて配置されている。

スクライブ室30には、ガラス基板2の所定の位置にスクライブラインを形成するためのカッター21（図2参照）が備えられる。

図2は、スクライブ室30に備えられるカッター21を示している。

このカッター21は、超硬または焼結ダイヤモンド等の高硬度を有する素材により形成された切刃22を有している。この切刃22は、中央部を最大径とする両円錐形状に形成されており、この切刃22の両端部は、下面を開放したホルダ23によって、その円錐形の軸を中心軸として回転できるように回転自在に支持されて取り付けられている。

このカッター21によりガラス基板2上にスクライブラインを形成するには、ホルダ23の下面から突出した切刃22の中央部をガラス基板2上の所望の位置に押し付けて切刃22を回転させながら所定の方向に走行することにより行う。

また、封止ガラスストック室213にストックされた封止ガラス300には、予め、ガラス基板2上に形成される有機発光層5等の各層が成膜された位置に対応して、この各層を覆う凹部が形成されていると共に、各有機ELディスプレイに分断するためのスクライブラインが形成されている。

この有機ELディスプレイ製造装置100によって有機ELディスプレイを製造する場合、まず、成膜室11の基板ストック室111にストックされたガラス基板2を搬送室110の搬送ロボット110aにより前処理室112に搬送して、所定の前処理を行った後、各蒸着室113～116に搬送して、所定のガスが所定圧に充填された条件の下に各層の成膜を行い、陽極層3、正孔輸送層4、有機発光層5、電子輸送層6、陰極層7の各層を順次、ガラス基板2上に積層して成膜する。この間、搬送室110と各室111～116との間に設けられたゲートバルブ111a～116aをそれぞれ開閉し、図示しないガス供給ライン及びガス排出ラインから所定のガスの導出入が行われるが、大気とは連通しないようにされる。

成膜室11にて各層が積層されたガラス基板2は、連絡通路13を通過して、気密状態が保たれたまま封止室20に搬送される。

以下、各層が成膜されたガラス基板2に封止ガラス300を取り付ける工程について、図3(a)～(e)を参照して説明する。

10

20

30

40

50

連絡通路 13 を通って封止室 20 に搬送されたガラス基板 2 は、図 3 (a) に示すように、所定の間隔毎に陽極層 3 等の各層が積層された状態となっている。搬送室 210 にガラス基板 2 が搬送されると、搬送室 210 の搬送ロボット 210a は、このガラス基板 2 を検査室 216 に搬送し、所定の検査が行われた後、スクライブ室 30 に搬入する。

スクライブ室 30 では、搬入されたガラス基板 2 を、光学アライメントを行い位置ズレ補正をした上で、予め設定されたスクライブピッチデータに従って X・Y のクロススクライブを行う。このクロススクライブでは、図 2 に示す切刃 22 を回転させながら走行することにより、図 3 (b) に示すように、ガラス基板 2 上の有機 EL ディスプレイとなる部分ごとにスクライブライン S を形成する。

次に、搬送室 210 の搬送ロボット 210a により、スクライブライン S が形成されたガラス基板 2 を封止ガラス固定室 212 に搬入し、封止ガラスストック室 213 にストックされた封止ガラス 300 を、ガラス基板 2 上に形成されたアライメントマークと封止ガラス 300 上に形成されたアライメントマークとが一致するように位置合わせして載置する。封止キャップ 300 は、ガラス基板 2 との接触面に UV 硬化性接着剤を介在させて載置される。

次に、搬送室 210 の搬送ロボット 210a により、封止ガラス 300 が載置されたガラス基板 2 を UV 照射室 214 に搬入し、図 3 (d) に示すように、ガラス基板 2 の裏面側から UV 光を照射して、封止ガラス 300 のガラス基板 2 に当接する当接面に塗布されている UV 硬化性接着剤を硬化させて、封止ガラス 300 をガラス基板 2 に固定する。

次に、搬送室 210 の搬送ロボット 210a により、封止ガラス 300 が固定されたガラス基板 2 を排出室 215 に搬送し、排出室 215 の減圧状態をゲートバルブ 215b を開放することによって大気圧に等しくして、排出室 215 の外部に封止ガラス 300 が取り付けられたガラス基板 2 を搬出する。

最後に、図 3 (e) に示すように、ガラス基板 2 及び封止ガラス 300 のそれぞれに所定のパターンに形成されたスクライブライン S をブレイクして、各有機 EL ディスプレイ毎に分断する。

以上に説明したように、本発明の EL ディスプレイ製造装置 100 によれば、ガラス基板 2 上に陽極層 3 等の各層を成膜した後、予め所定の位置にスクライブライン S を形成した封止ガラス 300 をガラス基板 2 上に載置して固定する。このように、1 枚板のガラス基板 2 に対して 1 枚板の封止ガラス 300 を貼り付けることによりガラス基板 2 上の有機発光層 5 等を封止するため、封止ガラス 300 の貼り付けのためのアライメントが容易である。

したがって、それぞれの有機 EL ディスプレイの層が成膜された位置のそれぞれに対応して封止キャップを取り付ける必要がないため、ガラス基板 2 に形成された各層が 150 面～200 面といった多面取りになっている場合に特に有効である。

本実施の形態では、予め、封止ガラス 300 の所定の位置にスクライブラインが形成されている場合を説明したが、予めスクライブ加工がされていない封止ガラス 300 をそのままチャンバー内でスクライブ加工されたガラス基板 2 へ貼り付けた後、チャンバーの外で封止ガラス 300 にスクライブ加工を施し、各有機 EL ディスプレイ毎に分断してもよい。

また、図 4 は、本発明の他の有機 EL ディスプレイ製造装置 100 の概略構成を示す構成図である。なお、製造される有機 EL ディスプレイ装置は、図 6 に示す構造と同様の構造になっている。

この有機 EL ディスプレイ製造装置 100 では、ガラス基板 2 を各有機 EL ディスプレイ毎に分断するためのスクライブライン S をガラス基板 2 の表面上に形成するためのスクライブ室 30 が、成膜室 11 及び封止室 20 の外部に設けられている。また、封止室 20 には、予備用に備えられている予備室 211 が設けられている。他の点は、図 1 に示す有機 EL ディスプレイ製造装置と同様の構成になっているので、詳しい説明は省略する。

この有機 EL ディスプレイ製造装置を用いて有機 EL ディスプレイを製造する場合には、まず、スクライブ室 30 にて、ガラス基板 2 上の所望の位置にスクライブライン S を形成

10

20

30

40

50

した後、スクライブラインSが形成されたガラス基板2を成膜室11の基板ストック室111に搬入する。その後、成膜室11の各室112～116に搬送室110の搬送ロボット110aにより搬送し、有機ELディスプレイの陽極層3等の各層を成膜する。

そして、各層の成膜がなされたガラス基板2は、連絡通路13を介して封止室20に搬送され、封止室20の搬送室210の搬送ロボット210aによって、封止室20の各室211～216に搬送されガラス基板2上の各有機ELディスプレイとなる領域に封止ガラス300を装着する工程がなされる。封止ガラス300が装着されたガラス基板2は、排出室215を通して外部に排出される。

また、図5は、本発明のさらに他の有機ELディスプレイ製造装置100の概略構成を示す構成図である。なお、製造される有機ELディスプレイ装置は、図6に示す構造と同様の構造になっている。 10

この有機ELディスプレイ製造装置100では、ガラス基板2を各有機ELディスプレイ毎に分断するためのスクライブラインSをガラス基板2の表面上に形成するためのスクライプ室30が成膜室11内に設けられている。また、封止室20には、予備として備えられる予備室211が設けられている。

この有機ELディスプレイ製造装置100を用いて有機ELディスプレイを製造する場合、まず、基板ストック室111にストックされたガラス基板2を搬送室110の搬送ロボット110aによって、ガラス基板2を成膜するための各室112～116に順次搬送し、有機ELディスプレイの各層を成膜する。その後、搬送ロボット110aによって、有機ELディスプレイの各層が成膜されたガラス基板2をスクライプ室30に搬送し、このスクライプ室30にてガラス基板2の表面上の所望の位置にスクライブラインSを形成する。なお、成膜室11におけるガラス基板2上への成膜工程及びスクライブライン形成工程は、上記のように成膜工程を行ってからスクライブラインSを形成する他、先にガラス基板2上にスクライブラインSを形成してから成膜工程を行うようにしてもよい。 20

そして、各層の成膜及びスクライブラインの形成が行われたガラス基板2は、連絡通路13を介して封止室20に搬送され、封止室20の搬送室210の搬送ロボット210aによって、封止室20内の各室212～216に搬送され、ガラス基板2上の各有機ELディスプレイとなる領域に封止ガラス300を装着する工程がなされる。封止ガラス300が装着されたガラス基板2は、排出室215を通して外部に排出される。

以上に説明したように、本発明の有機ELディスプレイ製造装置は、ガラス基板2上に封止ガラス300を装着する前に、ガラス基板2上にスクライブラインSを形成している。この場合、図1及び図5に示すように、ガラス基板2上に有機ELディスプレイとなる各層を形成した後に、真空または不活性ガスの雰囲気中でスクライブラインSを形成する工程を行うようにしてもよく、また、図4に示すように、成膜工程を行う前に、外部にて予めガラス基板2上にスクライブラインSを形成するようにしてもよい。 30

産業上の利用可能性

本発明の有機ELディスプレイ製造装置及び有機ELディスプレイの製造方法は、ガラス基板上に陽極層等の各層を成膜した後、1枚板のガラス基板に対して1枚板の封止部材を貼り付ける。これによりガラス基板と封止部材とのアライメントが容易になる。

【図面の簡単な説明】 40

図1は、本発明の有機ELディスプレイ製造装置の概略構成を示す模式的平面図である。

図2は、スクライプ室に備えられるガラスカッターを示す側面図である。

図3(a)～(e)は、それぞれ、各層が成膜されたガラス基板に封止ガラスを取り付けて、各有機ELディスプレイ毎に分断する工程を工程毎に説明する断面図である。

図4は、本発明の他の有機ELディスプレイ製造装置の概略構成を示す模式的平面図である。

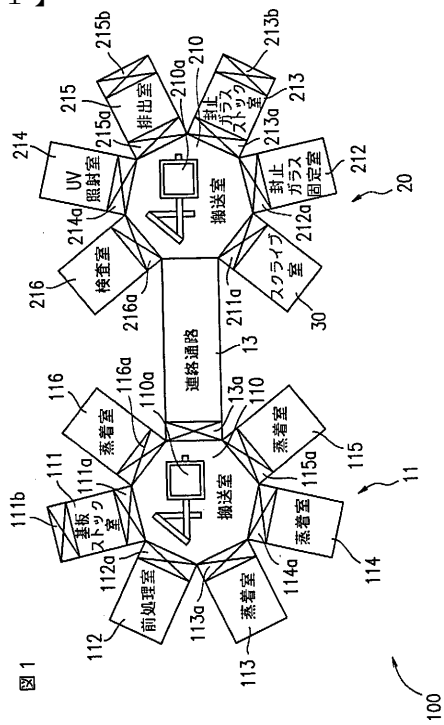
図5は、本発明のさらに他の有機ELディスプレイ製造装置の概略構成を示す模式的平面図である。

図6は、有機ELディスプレイの概略構成を示す斜視図である。

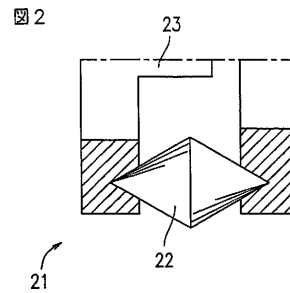
図7は、封止キャップを装着した有機ELディスプレイを示す断面図である。 50

図 8 は、従来の有機 EL ディスプレイ 製造装置の概略構成を示す模式的平面図である。

【図 1】

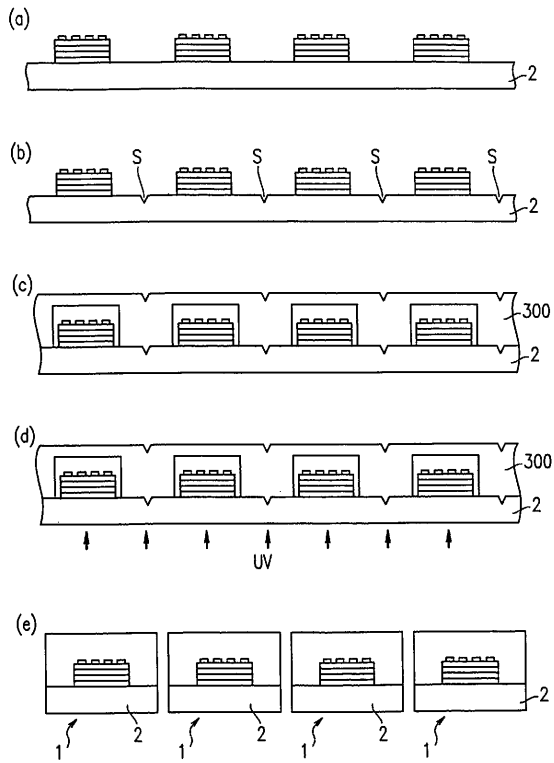


【図 2】



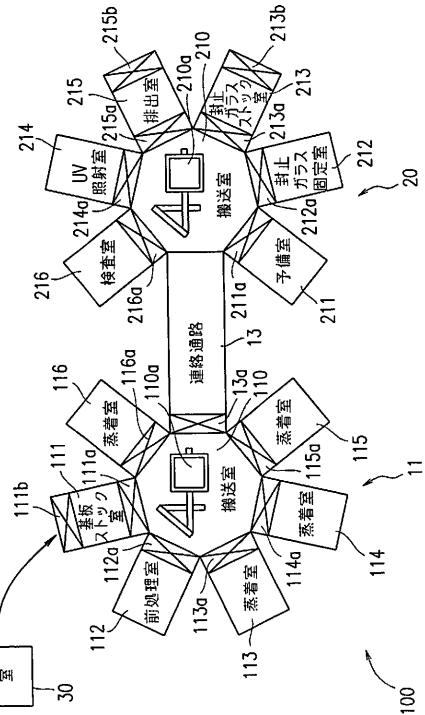
【図 3】

図 3



【図 4】

図 4



【図 5】

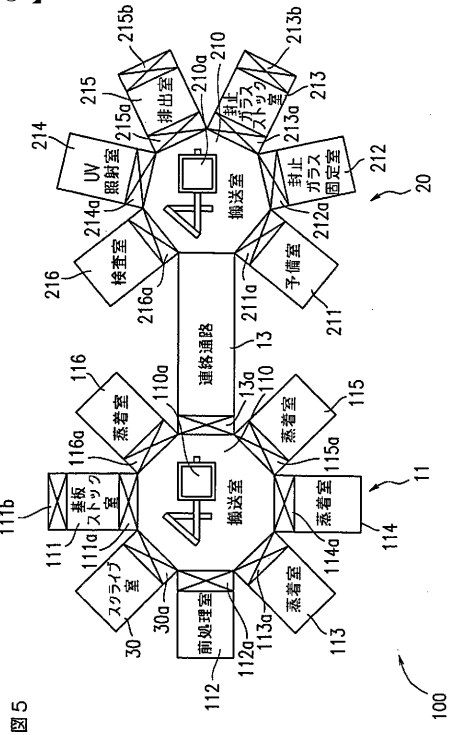
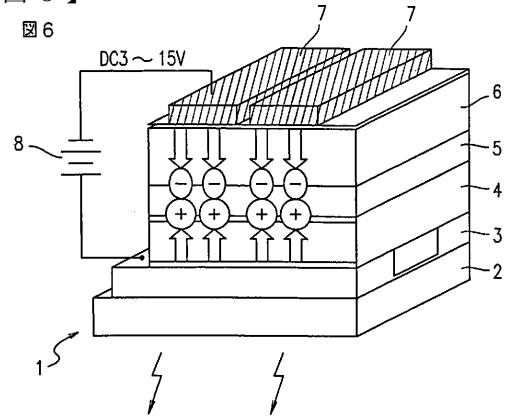


図 5

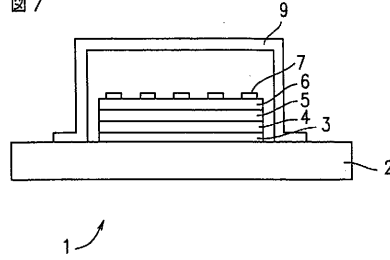
【図 6】

図 6



【図 7】

図 7



【図 8】

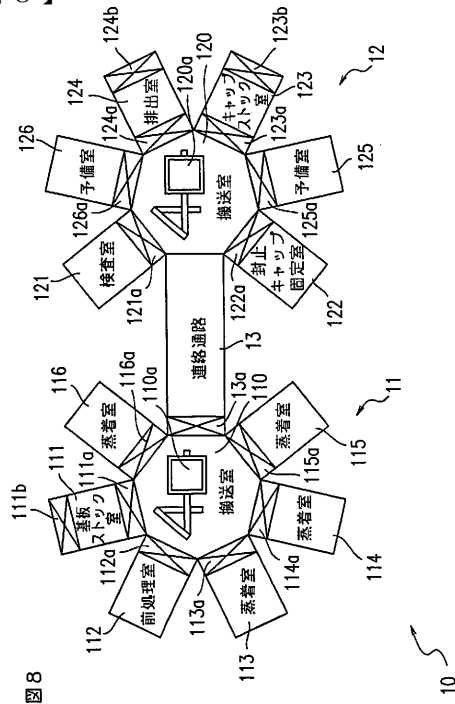


図 8

【手続補正書】

【提出日】平成15年1月10日(2003.1.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

真空または不活性ガス雰囲気中で、陽極層、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層、陰極層の各層を脆性基板上に、各有機 EL ディスプレイとなる部分毎に成膜する成膜手段と、真空または不活性ガス雰囲気中で、前記脆性基板上の各層を前記部分毎に気密状態に封止する封止部材を設ける封止手段と、

前記脆性基板の各有機 EL ディスプレイとなる部分毎に用いられる所定部分領域に対してスクライブラインを形成するスクライブ手段と、

を具備し、

前記スクライブ手段は、前記封止手段が前記脆性基板に封止部材を設ける前に、前記脆性基板にスクライブラインを形成し、

前記封止手段は、前記脆性基板上に形成された各有機 EL ディスプレイとなる部分毎に積層された各層をそれぞれ収納する凹部が予め形成されている封止部材を、前記スクライブラインが形成された脆性基板に対して封止することを特徴とする有機 EL ディスプレイ製造装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

前記スクライブ手段は、前記成膜手段により各層が成膜される脆性基板上に、真空または不活性ガス雰囲気中で、スクライブラインを形成するスクライブ手段を具備することを特徴とする請求の範囲第 1 項に記載の有機 E L ディスプレイ製造装置。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP02/05462
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl. ⁷ H05B33/14, 33/10 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl. ⁷ H05B33/00-33/28 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2001-68265 A (Toyota Motor Corp.), 16 March, 2001 (16.03.01), Full text; all drawings (Family: none)	1-7
A	JP 11-312580 A (Toyota Central Research And Development Laboratories, Inc.), 09 November, 1999 (09.11.99), Full text; all drawings (Family: none)	1-7
A	JP 2000-3782 A (Casio Computer Co., Ltd.), 07 January, 2000 (07.01.00), Full text; all drawings (Family: none)	1-7
A	JP 7-130472 A (Nippondenso Co., Ltd.), 19 May, 1995 (19.05.95), Full text; all drawings (Family: none)	1-7
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 14 August, 2002 (14.08.02)		Date of mailing of the international search report 27 August, 2002 (27.08.02)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP02/05462
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl. ⁷ H05B 33/14, 33/10		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl. ⁷ H05B 33/00-33/28		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2002年 日本国登録実用新案公報 1994-2002年 日本国実用新案登録公報 1996-2002年		
国際調査で利用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P 2001-68265 A (トヨタ自動車株式会社) 2001.03.16, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-7
A	J P 11-312580 A (株式会社豊田中央研究所) 1999.11.09, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-7
A	J P 2000-3782 A (カシオ計算機株式会社) 2000.01.07, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-7
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリ 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技术水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		
の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 14.08.02	国際調査報告の発送日 27.08.02	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区鷹が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 寺澤 恵司 電話番号 03-3581-1101 内線 3371	

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JPO2/05462
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 7-130472 A (日本電装株式会社) 1995. 05. 19, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-7

(注) この公表は、国際事務局（W I P O）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第 1 8 4 条の 1 0 第 1 項(実用新案法第 4 8 条の 1 3 第 2 項) により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	OLED显示器的制造装置和OLED显示器的制造方法		
公开(公告)号	JPWO2002104079A1	公开(公告)日	2004-10-07
申请号	JP2003506247	申请日	2002-06-03
[标]申请(专利权)人(译)	三星钻石工业股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星ダイヤモンド工業株式会社		
[标]发明人	若山治雄		
发明人	若山 治雄		
IPC分类号	H05B33/10 H01L51/52 H05B33/04 H05B33/14		
CPC分类号	H01L51/524		
FI分类号	H05B33/10 H05B33/04 H05B33/14.A		
优先权	2001180900 2001-06-14 JP		
其他公开文献	JP3602847B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

在玻璃基板2上形成有机EL显示器的阳极层3，空穴传输层4，有机发光层5和阴极层6之后，密封成为有机EL显示器的各层，例如有机发光层5。用于停止的板状密封玻璃300被放置并固定在玻璃基板2上。以这种方式，通过将单片密封玻璃300粘附到单片玻璃基板2上，当将密封玻璃300粘附到玻璃基板2上时，对准变得容易。

